

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 02-074901
 (43) Date of publication of application : 14. 03. 1990

(51) Int. Cl.

 G02B 1/10
 C08J 7/00
 // C03C 17/30
 C08J 7/04
 C09D183/02

(21) Application number : 63-227317 (71) Applicant : FUKUI PREF GOV
 (22) Date of filing : 10. 09. 1988 (72) Inventor : NISHIKAWA AKIFUMI

(54) METHOD OF IMPARTING ANTIREFLECTION FUNCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To impart an antireflection function to the surface of stocks by subjecting a transparent plastic stock and glass stock which consist essentially of the silicon chain compd. of polyorganosiloxane and are treated by a hard coating material to a low-temp. plasma treatment.

CONSTITUTION: The transparent plastic stock and glass stock which consist essentially of the silicon chain compd. of the polyorganosiloxane and are hard coated are irradiated with low-temp. plasma. The plasma treatment is determined by the components, pressure and flow rate of the gas and further the output and treatment time. The gaseous plasma include nitrogen, oxygen, hydrogen, argon; ozone, freon, etc., and polymerizable gaseous plasma which are usable alone or in combination. The gaseous oxygen is more particularly effective for its possibility of forming the antireflection film of porous layers consisting of SiO and SiO₂. The antireflection function is imparted to the surface region of the transparent plastic and glass stock by forming the porous layers of the metallic compd. SiO and SiO₂ which are known as antireflection films.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A) 平2-74901

⑫ Int. Cl.

G 02 B 1/10
C 08 J 7/00
// C 03 C 17/30
C 08 J 7/04
C 09 D 183/02

識別記号

306 PMN

府内整理番号

A 8106-2H
Z 8720-4F
M 8017-4G
7446-4F
6609-4J

⑬ 公開 平成2年(1990)3月14日

審査請求 有 請求項の数 1 (全8頁)

⑭ 発明の名称 反射防止機能付与法

⑮ 特 願 昭63-227317

⑯ 出 願 昭63(1988)9月10日

⑰ 発明者 西川 昭文 福井県勝山市本町4-4-5

⑱ 出願人 福井県 福井県福井市大手3丁目17番1号

明細書

1. 発明の名称

反射防止機能付与法

2. 特許請求の範囲

ポリオルガノシロキサンのケイ素系化合物を主成分としたハードコーティング材によって処理された、透明なプラスチック素材およびガラス素材を低圧プラズマ処理し、素材表面に反射防止機能を付与することを特徴とした反射防止機能付与法。

3. 発明の詳細な説明

発明の技術分野

本発明は透明なプラスチックおよびガラス表面の反射率低減方法に関するものである。更に詳しくは、ハードコートされた、透明なプラスチックおよびガラスを無機物、特に金属銀を蒸着することなく、低圧プラズマ処理することのみによって素材表面に反射防止機能を付与する方法に関するものである。

背景技術

光学機器に使われるレンズおよび窓などは必ずフレネル反射あるいはゴースト現象(化学と工業 第34巻171(1981, No.8)参照)が起きるので、反射防止膜加工を施して使用されている。また、この反射防止膜は吸収が少ないので反射防止効果とともに増透効果をももっている。レンズ表面の反射率低減および増透効果を行う方法として真空蒸着法あるいはスピッタリング法などがあり、それらの方法で無機化合物、特に金属銀を蒸着するのが一般的である。

現在使用されている蒸着材料としてはMgF₂が主で、ほかにはSiO₂、Al₂O₃などが用いられている。

一方、低屈折率の合フッ素ポリマーをレンズ表面にコートすることにより屈折率入射角を大きくし、反射率を低下する方法がある。バーフルオロアテン-2をプラズマ重合法によりレンズ表面にコートさせ、反射防止機能を付与している。(Applied Optics, Vol. 15, 132, 1076, No.1)

プラズマ処理による方法では多少の文献が見られるが、本発明のプラズマ処理による方法は当然で、全く新規な方法である。

発明が解決しようとする問題点

これらの金属蒸着法においては、ガラスレンズでは300～400℃の高温下で蒸着しうるのに対し、プラスチックレンズでは高溫処理によるレンズの白濁防止のために常温に近い低温下で蒸着しなければならず、またプラスチックレンズの場合易染性と言った長所が金属類の薄膜をレンズ表面にコートするため難染性になり、反射防止膜加工後の染色が不可能となる。それ故、反射防止膜加工前に染色しなければならず、プラスチックレンズの易染性と言った長所が半減し、この問題点を解決するのが期待されてい

問題を解決するための手段

本発明者は上記の点に着目し、さらに矯正用プラスチックレンズの将来性に着目し、透明なガラスおよびプラスチック素材の反射防止膜

貼付等について従来広範囲な系統的研究を行った結果、ハードコートされた、プラスチックおよびガラス素材を低温プラズマ照射することによって所期の効果が得られることを見い出し、本発明を完成した。

本発明の目的は、従来の技術である金属類の真空蒸着法を用いずに、低温プラズマ処理法により透明なプラスチックおよびガラス素材表面に反射防止機能を付与する方法を提供することにある。

すなわち、ポリオルガノシロキサンのケイ素類系化合物を主成分としたハードコーティング材によって処理された、透明なプラスチック素材およびガラス素材を低温プラズマ処理し、素材表面に反射防止機能を付与することを特徴とした反射防止機能付与法である。

他の目的は、反射防止機能付与後に染色可能な利点を提供することにある。すなわち、反射防止は正プラスチックレンズを消費者好みの色・相に染色可能な利点にある。

構成の説明

本発明の透明なプラスチックおよびガラス素材とは無色および有色のレンズを意味しているのであって、それらの板状素材をも意味する。

プラスチック素材はガラス素材に比べて「割れない」と言った長所があるのに対して、「柔らかいため傷がつきやすい」と言った短所をも持っている。この耐損傷性が悪い欠点に対してはハードコートによって補う技術が確立されている。ハードコーティング材としてはマルチラジカル架橋アクリル系樹脂や、アミノ樹脂硬化系ハードコーティング剤などの炭素系、およびオルガノシリコン化学に基盤を置くポリオルガノシロキサン系コーティング剤のケイ素類系の諸材料が用いられている。本発明のハードコーティング材とは上記のポリオルガノシロキサンのケイ素類系化合物を主成分としたハードコーティング材を意味するのであって、その処理法には湿式法および乾式法(CVD法をも含む)があり、いずれの方法も本発明に適用する。

本発明のハードコートされた透明なプラスチック素材およびガラス素材を低温プラズマ照射し、素材表面領域が活性化され、次いでSIO_xの膜が形成される。この素材表面領域の活性化を行うプラズマ処理条件の決定要素はガスの成分、圧力、流速であり、さらに出力、処理時間であり、これらにより反射防止機能を有するSIO_xの膜形成の可能性が決定される。

本発明のプラズマガスは窒素、酸素、水素、アルゴン、ネオン、ヘリウム、空気、水蒸気、塩素、アンモニア、一酸化炭素、二酸化炭素、亜酸化窒素、二酸化窒素、二酸化イオウ等があり、さらに重合性プラズマガスがあり、これらは單独または混合して使用可能であるが、特にSIO_xの膜形成の可能性から酸素ガスが有効である。一方、酸素を含まないガスでは低温プラズマ処理によってラジカル化し、大気中に取り出すとき放電と結合して膜を形成すると考えられるため反射防止効果は非常に小さい。

本発明の目的を達成するには、低圧プラズマ処理ガスの分圧50トル以下、より好ましくは 5×10^{-1} トル以下の雰囲気とすることが望ましい。20トルを越える分圧をもつプラズマ等圧気中では、プラズマ処理の効果が急激に低下する。プラズマガスの流量は反応器の容積およびプラズマガスの分圧により決定される。

出力は一般に500ワット以下で使用される場合が多いが、処理時間との組合せにより目的の性能をうることが可能である。

プラズマ処理時間は素材の種類や形状および処理負担などによって異なるが、通常数秒から数分間であり、好ましくは1分～5分間程度である。

プラズマガスを、ハードコートされたプラスチック素材およびガラス素材の表面に作用させる場合、多くの組合せが考えられる。すなわち、反応器の構造、電源の種類、周波数、放電形式および電極の位置などさまざまの選択が可能である。

処理時間：2分

なお、比較のためにハードコーティング材で処理されていない上記と同様の素材、プラスチックレンズ(CR-39)およびガラスレンズについても同一の条件で低圧プラズマ処理した。

その結果、ハードコートされたガラスレンズ、プラスチックレンズのいずれの素材もSIO₂膜持有的マゼンタの色相を呈し、反射防止機能を示していたが、ハードコートされていないガラスレンズ、プラスチックレンズのいずれの素材も反射防止膜持有的の色相を呈していなかった。

なお、プラズマ処理されていないハードコートプラスチックレンズ(試料No.Ⅰ)およびプラズマ処理されたハードコートプラスチックレンズ(試料No.Ⅱ)について可視光の透過率を表1に示す。

この結果より、試料No.Ⅰより試料No.Ⅱの方が透過率4～5%高い。

プラズマ処理にあたり、電源としては高周波(13.56MHz)、マイクロ波(2.45GHz)、低周波(数kHz)などがある。放電方式としてはグロー放電が有効である。また、電極の位置については内部式および外部式等があるが、効果の均一性を考えれば内部式の方が操作が容易である。

以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

実施例1

オルガノシロキサン系化合物を主成分としたハードコーティング材(市販名 TS-56-T 徳山ソーダ製)で処理された透明なプラスチックレンズ(CR-39)およびガラスレンズを下記の条件で低圧プラズマ処理した。

【プラズマ処理条件】

雰囲気ガス: O₂ 20ml/min

分圧度: 0.2torr

出力: 300W

表 1

試料	波長(nm)			
	425	500	600	700
Ⅰ	90.8%	91.4	91.9	92.5
Ⅱ	95.1	97.1	95.5	96.4

実施例2

実施例1と同様なハードコーティング材で処理された透明なプラスチック板およびガラス板についても実施例1と同様の条件で低圧プラズマ処理した結果、同様な反射防止機能が付与された。

なお、実施例1のプラズマ処理条件の1つである雰囲気ガスをアルゴンにし、他は同様の条件でプラズマ処理を行った結果、少々の反射防止効果がみられた。

昭和63年12月7日

発明の効果

本発明の特徴は金属銀の真空蒸着法と言った従来の技術を用いないで素材表面領域のケイ素ガラス系化合物が低圧プラズマ処理によって表面活性化され、次いで反射防止機能を有する SiO_2 の膜が素材表面に形成される。

さらに、本発明の反射防止機能付与法は真空蒸着の方法やイオンプレーティングの高真空も必要なく、プラスチック素材の易染性を変えることがないなど多くの特徴を有している。

また素材については、並に矯正用レンズに限るものではなく、例えば化粧用鏡、自動車用パッケミラー、フェンダーミラー、道路用反射ミラー、住宅用鏡など、その応用範囲は多岐に渡っている。

特許出願人 西川昭文

特許庁長官印

1. 事件の表示

昭和63年特許第227317号

2. 発明の名稱

ガラスガラクタフミカ

反射防止機能付与法

3. 締正をする者

特許出願人

西川 昭文
住所(居所) 〒911 福井県越前市本町4丁目4-5
郵便番号 911-0004
氏名(名跡) 西川 昭文

4. 締正の対象

出願明細書の発明の詳細な説明

5. 締正の内容

明細書第2頁～11頁を別添付書とのおり締正する。

6. 添付書類の目録

明細書第2頁～15頁

1通

昭和63年12月7日

光学機器に使われるレンズおよび鏡などは必ずフレネル反射あるいはゴースト現象(化学と工具 第34巻171(1981, No.8)参照)が起るので、反射防止構造加工を施して使用されている。このような反射防止技術は主として光学材料の性能向上を目的に発展してきたが、近年各種表示装置の視角性の改良や太陽熱利用技術面での材料による反射ロスの減少等、他の分野においても反射防止の重要性はとみに高まっている。方法的には、薄膜コーティングおよびガラスなどの素材表面変成の2通りある。これらの中には、①低屈折率膜、②多層干渉膜、③多孔質膜のいずれかによる必要がある。①低屈折率膜は光の干涉効果を応用するもので、低屈折率材料(例えば、 MgF_2 、水晶石・ AlF_3 ・ NaF)の被膜を行う。他の例としては、低屈折率のヒツジガラスポリマーをレンズ表面にコートすることにより界面入射角を大きくし、反射率を低下する方法がある。バーフルオロアテン-2をプラズマ重合法によりレンズ表

面にコートさせ、反射防止機能を付与している。(Applied Optics, Vol.15, 132, 1976, Vol.)

②多層干渉膜は光の干涉理論に基づき高屈折率膜、低屈折率膜を交互に積層したもので、マルチコートと呼ばれる由来である。これは單層膜に比べて反射率が低く、かつその分光特性は厚歎に応じた広い低反射域(成長域)を有している。材料的には、通常、低屈折率膜として MgF_2 ・ SiO_2 (屈折率1.46)が、高屈折率膜として TiO_2 (屈折率2.3)がよく用いられる。この方法が、レンズなどの透明な素材表面の反射率低減および増透効果(反射防止膜は吸収が少ないので反射防止効果とともに増透効果をもつている)を行う方法として利用されている。これには真空蒸着あるいはスパッタリング法などがある。

現在使用されている高耐材目としては、この他に Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 などが用いられている。

③多孔質膜は、ガラス表面を酸溶液で処理した

ときには漏れるスケルトン層で代替されるよう
に、シリカなど低屈折率誘電体の針状またはス
ポンジ状構造より成る。

本発明の低屈折率誘電体による方法は多
孔質層によるものであり、本発明に関する文献
などは皆無で、全く斬新な方法である。

発明が解決しようとする問題点

これら①、④の金属蒸着法においては、ガラ
スレンズでは300～400℃の高温下で蒸着
しするのに対し、プラスチックレンズでは高温
処理によるレンズの白濁防止のために常温に近い
低温下で蒸着しなければならず、いろいろな
工夫が必要となり、複層の複雑化と操作の煩雑化
が問題となっている。また、プラスチックレンズ
の場合易染性と言った長所が金属膜の薄膜
をレンズ表面にコートするため難染性になり、
反射防止膜加工後の染色が不可能となる。それ
故、反射防止膜加工前に染色しなければならず、
プラスチックレンズの易染性と言った長所が半
減し、この問題点を解決するのが期待されてい

る。

問題を解決するための手段

本発明者は上記の点に着目し、さらに矯正
用プラスチックレンズの耐光性および太陽熱利
用に着目し、透明なガラス素材およびプラスチ
ック素材の反射防止機能付与について慎重に範
囲な系統的研究を行った結果、コーティングさ
れた、プラスチック素材およびガラス素材を低
温プラズマ照射することによって所要の効果が
得られることを見出だし、本発明を完成した。

低温プラズマによって素材表面領域数10⁻²cm²～数10⁻³cm²の範囲内でエッティングされ、
分解されることは既知の如くである。この現象に
着目し、表面領域でシリコン系ハードコート
材をエッティングし、分解することによってSi
O_xSiO_yの多孔質層の反射防止膜を作成する
ことに成功した。

本発明の目的は、従来の技術である金属膜の
真空蒸着法を用いずに、低温プラズマ処理法に
より透明なプラスチックおよびガラス素材表面

領域に、反射防止膜として知られている金属化
合物SiO_xおよびSiO_yの多孔質層を形成し、
反射防止機能を付与する方法を提供することに
ある。

他の目的は、反射防止機能付与後に染色可能な
利点を提供することにある。すなわち、反射
防止膜正プラスチックレンズを消費者好みの色
相に染色可能な利点にある。

すなわち、ポリオルガノシロキサンのケイ素
系化合物を主成分としたハードコーティング
材によって処理された、透明なプラスチック材
料およびガラス素材を低温プラズマ処理し、
素材表面に反射防止機能を付与することを特徴と
した反射防止機能付与法である。

構成の説明

本発明の透明なプラスチック素材およびガラ
ス素材とは無色および有色のレンズを意味して
いるのであって、それらの板状素材をも意味す
る。

プラスチック素材はガラス素材に比べて「耐

れない」と言った長所があるのに対して、「柔
らかいため傷がつき易い」と言った短所をも持
っている。この耐傷性が悪い欠点に対しては
ハードコートによって補う技術が確立されてい
る。ハードコーティング材としてはマルチラジ
カル架橋アクリル系剤や、アミノ樹脂硬化系ハ
ードコーティング剤などの成膜組成、およびオ
ルガノシリコン化学に基盤を置くポリオルガノ
シロキサン系コーティング剤のケイ素系の諸
材料が用いられている。本発明のハードコーテ
ィング材とは上記のポリオルガノシロキサンの
ケイ素系化合物を主成分としたハードコーテ
ィング材を意味するのであって、その処理法に
は擦式法および乾式法(CVD法をも含む)
があり、いずれの方法も本発明に適用する。

本発明のハードコートされた透明なプラスチ
ック素材およびガラス素材を低温プラズマ照射
し、素材表面領域が活性化され、SiO_xおよび
SiO_yの多孔質層の反射防止膜が形成される。
この素材表面領域の活性化を行うプラズマ処理

条件の決定要因はガスの成分、圧力、温度であり、さらに出力、処理時間であり、これらにより反射防止機能を有する SiO_2 、 SiO_2 の膜形成の可能性が決定される。

本発明のプラズマガスは窒素、酸素、水素、アルゴン、ネオン、ヘリウム、空気、水蒸気、塩素、アンモニア、一酸化炭素、二酸化炭素、亜酸化窒素、二酸化窒素、二酸化イオウ、フロン等があり、さらに混合性プラズマガスがあり、これらは単独または混合して使用可能であるが、特に SiO_2 、 SiO_2 の多孔質層の反反射防止膜形成の可能性から酸素ガスが有効である。一方、酸素を含まないガスでも低温プラズマ処理によってラジカル化し、大気中に取り出すとき酸素と結合するか、あるいはコート材中の酸素と結合して SiO_2 、 SiO_2 の多孔質層の反反射防止膜を形成すると考えられ、反反射効果はある。

本発明の目的を達成するには、低温プラズマ処理ガスの分圧 50 ポルト以下、より好ましくは 5×10^{-1} ポルト以下の雰囲気とすることが望ま

方式としてはグロー放電が有効である。また、電極の位置については内部式および外部式等があるが、効果の均一性を考えれば内部式の方が操作が容易である。

以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

実施例 1

オルガノシロキサン系化合物を主成分としたハードコーティング材（市販名 TS-56-T 徳山ソーダ㈱製）で処理された透明なプラスチックレンズ（CR-39）およびガラスレンズを下記の条件で低温プラズマ処理した。

〔プラズマ処理条件〕

雰囲気ガス： O_2 20 ml/min
減圧度： 0.2 torr
出力： 300 W
処理時間： 2 分

なお、比較のためにハードコーティング材で処理されていない上記と同様の素材、プラスチッ

ク。 20 ポルトを越える分圧をもつプラズマ雰囲気中では、プラズマ処理の効果が急激に低下する。プラズマガスの流量は反応器の容積およびプラズマガスの分圧により決定される。

出力は一般に 500 ワット以下で使用される場合が多いが、処理時間との組合せにより目的の性能をうることが可能である。

プラズマ処理時間は素材の種類や形状および処理目標などによって異なるが、通常数秒から数分間であり、好ましくは 1 分～5 分間程度である。

プラズマガスを、ハードコートされたプラスチック素材およびガラス素材の表面に作用させる場合、多くの組合せが考えられる。すなわち、反応器の構造、電極の種類、周波数、放電形式および電極の位置などさまざまの選択が可能である。

プラズマ処理にあたり、電源としては高周波（13.56 MHz）、マイクロ波（2.45 GHz）、低周波（数 kHz）などがある。放電

クレンズ（CR-39）およびガラスレンズについても同一の条件で低温プラズマ処理した。

その結果、コーティングされたガラスレンズ、プラスチックレンズのいずれの素材も SiO_2 、 SiO_2 多孔質層特有の反反射機能（マゼンタの色相）を示していたが、コーティングされていないガラスレンズ、プラスチックレンズのいずれの素材も反反射機能特有の色相を呈していなかった。

なお、プラズマ処理されていないハードコーティングプラスチックレンズ（試料 N.O.I）およびプラズマ処理されたハードコーティングプラスチックレンズ（試料 N.O.II）について SEM によるそれらの表面写真（写真 1、2）、E SCA による表面分析結果（表 1）および可視光の反射率（表 2）および透過率（表 3）を示す。

以下余白

界を同時にそれぞれ適しく改進させることができた。

表 2 反 射 率 (%)

試 料	波 長 (nm)			
	450	500	600	700
I	8.95%	8.06	8.98	8.95
II	5.81%	5.38	5.52	5.97

表 3 透 過 率 (%)

試 料	波 長 (nm)			
	425	500	600	700
I	90.8%	91.4	91.3	92.5
II	95.1%	97.1	95.5	96.4

これらの結果より太陽エネルギー、5. 28
(1980, No. 2) に記載されていると同様な SiO_2 オおよび SiO_2 のポーラスな反射防止機能膜を作成することができた。

実施例 2

実施例 1 と同様なハードコーティング材で処

写真 1
試料 N o I の表面写真
X 10000

写真 2
試料 N o II の表面写真
X 10000

図 1 ESCA によるフ'52-7処理前後の表面状態分析

元素比	フ'52-7処理前	フ'52-7処理後
O/Si	2.43	2.27
Si/C	0.23	1.35

低圧プラズマ処理によって、写真 1, 2 では
試料表面が強くエッティングされ、多孔質層とな
った。表 1 では、O/Si の比が変わらないのに対
して Si/C の比が大きくなっていることより Si-C
結合が分解され Si-O 結合になっている。また、
表 2, 3 では反射率は非常に小さくなり反射防
止効果を、また透過率は非常に高くなり増透効

理された透明なプラスチック板およびガラス板
についても実施例 1 と同様の条件で低圧プラズ
マ処理した結果、同様な反射防止機能が付与さ
れた。

なお、実施例 1 のプラズマ処理条件の 1 つで
ある等圧ガスをアルゴンにし、他は実施例 1
と同様の条件でプラズマ処理を行った結果、多
少の反射防止効果がえられた。

発明の效果

本発明の特徴は金属類の真空蒸着法と言った
従来の技術を用いないで素材表面領域のケイ素
組合物が低圧プラズマ処理によって表面活
性化され、反射防止機能を有する SiO_2 オおよび
 SiO_2 の多孔質膜が素材表面に容易に形成され
るので真空蒸着の高圧やイオンプレーティング
の高真空と言った必要もない。そのため、荷重
の複雑化と操作の煩雑化がなく、熱処理を要しない。
い。

また、真空蒸着法で行った反射防止機能付与
法ではプラスチック素材の易染性を変え、難染

性になるのに対して、本発明法ではプラスチック
素材の易染性を変えることがないなど多くの
特徴を有している。

また素材については、単に矯正用レンズに限
るものではなく、例えばサンシャイン計画の一
分野である太陽暖房始源遮光装置など、その応用
範囲は多岐に渡っている。

特許出願人 西川昭文

手 紙 税 正 日

平成元年1月17日

特許長官印

1. 事件の表示

昭和63年特許第227317号

2. 免明の名称

反射防止機能付与法

3. 税正をする者

特許出願人

住所(店所) 〒911-5277 愛知県豊山市本町4丁目4-5

氏名(名称) 西川昭文(セイカワ ハヤト)

4. 税正による請求項の数

4

5. 税正の対象

出願明細書の特許請求の範囲の項

6. 税正の内容

出願明細書の特許請求の範囲「ポリオルガノシロキサンのケイ素系化合物を主成分としたハードコーティング材によって処理された。………

……特徴とした反射防止機能付与方法。」を下記の如く訂正する。

1. ハードコーティング材によって処理された素材を低温プラズマ処理し、
素材表面に反射防止機能を付与することを特徴とした反射防止機能付与方法。
2. ハードコーティング材がポリオルガノシロキサンのケイ素系化合物
を主成分である特許請求の範囲第1項記載の反射防止機能付与法。
3. 素材が透明なプラスチックおよびガラスである特許請求の範囲第1項
記載の反射防止機能付与法。
4. 低温プラズマ処理がガス圧0.01~10トルの無機および有機ガスの低温
プラズマ照射である特許請求の範囲第1項記載の反射防止機能付与法。



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.